文章编号:1000-7032(2023)06-1069-08

基于 PtOEP 分子温度探针对 OLED 结温的判定及实验研究

丁 川¹,姜雪松²,许正印²,王忠强¹,王 华^{1*}
 (1.太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室,山西太原 030024;
 2.江苏三月科技股份有限公司,江苏无锡 214112)

摘要:使用正性光敏聚酰亚胺(PSPI)和光刻技术制备了一系列不同图案化的有机发光二极管(OLED)器件, 以铂八乙基卟啉(PtOEP)作为分子温度探针探究不同图案化OLED所产生的热效应,并进一步研究不同热效 应对OLED器件的影响。结果表明,像素尺寸在500μm以下时,器件工作中产生的热效应与像素尺寸呈正相 关,且与线宽和总开口面积无关;而像素尺寸达到500μm以上时,器件中产生的热效应没有进一步增长。其 中5μm孔径的像素在室温10mA/cm²电流密度下工作时,器件的温度为303.29K,而相同条件下像素尺寸为 2000μm时,器件温度可高达314.65K;当环境温度升至323.15K时,器件所产生的热效应呈现相同的趋势。 具有不同热效应器件的外量子效率曲线表明,器件温度的升高导致外量子效率降低,其原因是温度升高导致 载流子迁移速率加快,但同时也使三线态激子之间及激子与极化子之间的碰撞概率升高,从而加剧激子猝灭, 导致效率下降。

关键 词:图案化OLED; PtOEP; 分子温度探针; 结温
 中图分类号: TN312.8 文献标识码: A DOI: 10.37188/CJL.20220417

Determination and Experimental Study of OLED Junction Temperature Based on PtOEP Molecular Temperature Probe

DING Chuan¹, JIANG Xuesong², XU Zhengyin², WANG Zhongqiang¹, WANG Hua^{1*}

 $(1.\ Key\ Laboratory\ of\ Interface\ Science\ and\ Engineering\ in\ Advanced\ Materials\ ,\ Ministry\ of\ Education\ ,$

 $Taiyuan\ University\ of\ Technology\ ,\ Taiyuan\ 030024\ ,\ China\ ;$

2. Jiangsu Sunera Technology Co., Ltd, Wuxi 214112, China)

 $*\ Corresponding\ Author\,,\ E\text{-mail}:\ wanghua 001 @tyut.\ edu.\ cn$

Abstract: The thermal effect of OLED device was studied by PtOEP molecular temperature probe and different patterned OLED substrate, which was prepared with positive photosensitive polyimide (PSPI) and photolithography. The results show when the pixel size is less than 500 μ m, the thermal effect is positively correlated with the pixel size, and independent of the line width and total opening area. However, when the pixel size reaches more than 500 μ m, the thermal effect does not increase further. When 5 μ m pixel works at a current density of 10 mA/cm² at room temperature, the temperature of the device is 303.29 K. When the pixel size is 2 000 μ m under the same conditions, the device temperature can reach 314.65 K. When the ambient temperature rises to 323.15 K, the thermal efffect of the device shows the same trend. The EQE curves of devices with different thermal effects show that the increase of device temperature leads to the decrease of external quantum efficiency. The reason is that the increase of temperature improves carrier migration rate, but also increases the probability of collision between triplet excitons and between excitons and polarons, which leads to the exciton quenching and the decrease of efficiency.

Key words: patterned OLED; PtOEP; molecular temperature probe; junction temperature

Supported by Shanxi Provincial Natural Science Foundation(20210302123149); Research Project Supported by Shanxi Scholarship Council of China(2022-046)

收稿日期: 2022-12-16;修订日期: 2023-01-03

基金项目:山西省自然科学基金(20210302123149);山西省回国留学人员科研资助项目(2022-046)

1引言

随着显示技术的发展,相较于液晶显示器 (LCD)而言,有机发光二极管(OLED)具有高效、 轻薄、响应速度快等优点,从而成为新一代显示技 术^[1]。然而,迄今为止,OLED的寿命和效率仍是 制约其发展的重要因素。除水氧因素外,其自身 所产生的热效应对器件寿命和效率的影响同样不 可小觑。得益于光刻技术的发展,OLED的分辨 率逐步攀升,高分辨率的OLED已逐步被应用于 AR、VR等新兴产业^{III}。而分辨率的提升源于像素 点的缩小,不同大小的像素阵列不仅导致分辨率 不同,其对 OLED 的电流注入、热效应等均会产生 影响,而电流注入以及热效应将直接影响 OLED 器件的发光效率和寿命[2-3]。在手机高负荷运行 10~60 min 时,手机 CPU 附近温度可高达 50 ℃左 右^[4],其温度将与OLED本身所产生的热效应相叠 加,对OLED屏幕产生不利影响。在OLED工作过 程中,传热方式主要为热传导、辐射和对流等,而 对于大尺寸器件,对流较差且缺乏横向热传输[5-6], 因此在大尺寸器件中可能会产生更为严重的热效 应。同时,局部焦耳热会加速材料的劣化并产生 发光衰减、亮度分布不均匀等问题^[79]。因此对于 实际应用中OLED不同像素所产生热效应的研究 意义重大。

针对热效应的研究通常采用红外热成像测试^[8]和有限元分析^[10-11]等方式获取温度信息。而红 外热成像测试等手段只能测得器件表面温度,难 以准确获取结温。因此人们将目光转移至分子温 度计,随着分子温度探针技术的成熟化,其不仅可 以获取半导体工作过程中的实际温度,且具有高 灵敏度、快速响应和在线可视化等优点^[12],已逐步 被应用于微小空间的温度探测。其中PtOEP中特 有的热填充的三线态使其具有温度敏感性^[13-17],可 通过光谱得到器件中的温度,从而快速准确地探 测不同大小的像素所产生的热效应。因此,本文 在 PSPI图案化的基础上,制备 PtOEP 红光器件, 并利用 PtOEP 温度敏感性探测 OLED 器件的结 温,探究不同像素所产生的热效应以及热效应对 OLED 器件的影响。

2 实 验

OLED器件中所使用的有机材料均由江苏三 月科技股份有限公司提供,图案化材料 PSPI 由烟 台三月科技有限责任公司提供。器件结构为: ITO/N-[1,1'-联苯]-2-基-2',7'-双(1,1-二甲基乙



图1 (a)器件结构示意图;(b)能级图;(c)有机材料的分子结构。

Fig.1 (a)Schematic diagram of device structure. (b)Energy level diagram. (c)Molecular structures of organic materials.

基)-N-(9,9-二甲基-9H-芴-2-基)-9,9'-螺并[9H-芴]-2-胺(NYS):3%(1E,2E,3E)-1,2,3-三(1-(4-乙 炔基-2,3,5,6-四甲基苯基)丙-2-炔-1-亚基)环丙烷 (ETP)(10 nm)/NYS(40 nm)/N-[1,1'-联苯]-4-基 -N-(9,9-二甲基-9H-芴-2-基)-11,11-二甲基-11H-苯并[b]芴-5-胺(NHF)(10 nm)/4,4-二(9-咔唑)联 苯(CBP):5%PtOEP(30 nm)/2-(5'-(4,6-二苯基嘧 啶-2-基)-[1,1';2'-三联苯基]-3-基)-4,6-二苯基-1, 3,5-三嗪(DTD):Liq(1:1)(40 nm)/Yb(1 nm)/Ag: Mg(9:1)(80 nm),如图1(a)所示。器件能级排列 如图1(b)所示,有机材料的分子结构如图1(c)所 示。器件制备流程如下:首先将 ITO 基板放入清 洗机清洗,清洗步骤为:(1)高压冲洗,(2)338.7K 热水冲洗,(3)使用M-L20清洗剂刷洗,(4)清水刷 洗,(5)338.7 K 热水冲洗,(6) 高压冲洗,(7) 兆声 波清洗,(8)338.7 K 热水冲洗,(9)1 500 r/min 甩 干,(10)200 °C/30 min 烘干。其次使用 PSPI 在 ITO 基板上形成 0.5 µm 厚的薄膜, 经过 100 ℃/ 120 s的预固化后,使用光刻机对其曝光,再通过 碱性显影液显影,使其形成图案化;图案化之后将 其在220℃下完成最终固化,形成图案化基板。 随后将基板放入清洗机清洗,清洗流程同上。将 基板传入真空腔体的有机腔,真空度为5.28×10-5 Pa (3.96×10⁻⁷ torr),依次沉积NYS: 3%ETP (10 nm) NYS(40 nm) NHF(10 nm) CBP: 5%PtOEP (30 nm)、DTD:Liq(1:1)(40 nm)。再将基板传入 真空度为1.35×10⁻⁵ Pa(1.01×10⁻⁷ torr)的金属腔,

依次蒸镀 Yb(1 nm)和 Ag: Mg(9:1)(80 nm)。最 后将器件传入氮气氛围的手套箱内进行点胶封 装。文中采用的蒸镀设备为长州产业株式会社 1504-10117-01型号的蒸镀设备。封装系统采用 布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司、MB200 MOD型号的惰性气氛手套箱 OLED 器件用封装系 统。器件的光电性能测试采用弗士达公司的 FS-1000GA4 测试系统。显微镜采用 Nikon 公司的 ECLIPSELV100ND 金相显微镜,用以观察光刻所 形成的图案。

3 结果与讨论

3.1 图案化基板制备

图案化基板的设计如下:在50 mm×50 mm基 板中4个2 mm×2 mm的正方形内通过光刻形成不 同的像素排列。不同像素阵列的显微镜图如图2 所示。设计像素形状为正方形,边长分别为6, 50,500 µm,其中50 µm孔径图案采用30 µm和 50 µm两种线宽,如图2(b)、(c)所示,用以探究像 素大小一致、而总开口面积不同时所产生的热效 应是否一致。以上四种像素排列均分布在边长为 2 000 µm的正方形内。由于光刻机和图案化掩 膜版存在一定的误差,导致最终形成的图案与设 计图案之间存在一定的误差,导致最终形成的图案与设 计图案之间存在一定的误差,导致最终形成的图案与设 计图案之间存在一定的误差。50 µm和500 µm 的孔径均形成良好的正方形图案,6 µm孔径的图 案则最终形成直径为6 µm左右的圆形。因此,本 文通过显微镜测量确认最终形成图案尺寸,具体



图 2 不同图案化基板的显微镜照片,像素与线宽分别为6 μm/4 μm(a)、50 μm/30 μm(b)、50 μm/50 μm(c)、500 μm/500 μm(d)。

Fig.2 Photomicrograph of different patterned substrates, pixel and line width are 6 μm/4 μm(a), 50 μm/30 μm(b), 50 μm/ 50 μm(c) and 500 μm/500 μm(d), respectively.

像素尺寸和线宽数据如表1所示,无图案化的器 件则是边长为2000 μm的正方形。

Tab.

表1 不同图案化基板的像素及线宽

基板编号	像素点尺寸	像素点数量/个	线宽/µm
а	6 μm×6 μm	40 000	4
b	50 μm×50 μm	624	30
с	50 μm×50 μm	400	50
d	500 μm×500 μm	4	500
e	$2~000~\mu\mathrm{m}{\times}2~000~\mu\mathrm{m}$	1	无

3.2 PtOEP分子温度探针原理

图 3 (a) 为 298.15~353.15 K 不 同 温度下 PtOEP 器件的归一化电致发光(EL)光谱,电流 密度为 1 mA/cm²,采用基板为无图案化基板。 图 3 (a)表明, PtOEP 的主发射峰位于 650 nm 处。图 3 (b)为图 3 (a)中 400~600 nm 范围内放 大后的光谱,表明 543 nm 处存在一个微弱的发 射峰,且随温度升高归一化峰值升高,与之前的 研究结果一致^[14-17]。如图 3 (a)所示, 543 nm 发 射来源于高温活化能为 0.42 eV 的第一激发三 线态发射^{16]},由热激活产生,与温度密切相关, 被称为热带发射。因而本文通过其峰值与温度 之间的变化关系来预测图案化器件工作中产生 的热效应。由于低电流密度下热效应可忽略不 计,因此本文选用在 1 mA/cm²电流密度下,通过 无图案化器件不同温度的 EL 光谱确认不同温 度所对应 543 nm 的峰值,进而以该基准预测图 案化器件中的热效应。





Fig.3 (a)Normalized EL spectra of unpatterned devices at a current density of 1 mA/cm². (b)The magnification of the 400-600 nm range in figure (a). (c)Fitting curve of normalized 543 nm EL peak intensity plotted against temperature.

图 3(c)所示为归一化后 543 nm 处 EL峰值随 温度的变化趋势,可根据变化趋势将其拟合为函 数 $Y = 221.307 \times e^{-3491.899/T}$,其中 Y为归一化之后 543 nm 处的 EL峰值,T为温度。拟合函数的拟合 优度 R^2 为 0.998 9,残差均方为 1.37×10⁻⁸,因此所 拟合函数的拟合优度较高。图 3(c)中红色实线 为拟合曲线,后续可根据该函数来确定不同峰值 所对应的温度。

3.3 室温下不同图案化OLED热效应分析

不同图案化器件室温测得 EL 光谱如图 4(a) 所示,器件 A、B、C、D、E分别对应基板 a、b、c、d、e。 图 4(b)为图 4(a)中 400~600 nm 范围内放大后的 光谱。543 nm 处的峰值高度与像素点大小呈正 相关,说明像素点越大,器件所产生的热效应越显 著。器件B和器件C像素点大小相同,线宽与总 开口面积不同,但器件B和器件C在543 nm处的 峰值一致,表明线宽和总开口面积对热效应无显 著影响。这是由于像素尺寸相同时,器件与周围 介质的接触面积相同,其热传导效应一致,因此线 宽与总开口面积对器件热效应无显著影响^[6]。器 件D和器件E在543 nm处峰值趋于一致,该情况 可能是由于辐射和对流等传热作用的影响^[5-6],使 像素大小在500 µm以上器件的热效应一致。

通过图 3(c) 拟合指数函数计算上述不同图 案化中的热效应,可知 A、B、C、D、E器件中的温度 分别为 303. 28,312. 15,311. 65,314. 57,314. 65 K。



- 图4 (a)室温下器件在10 mA/cm²电流密度下的归一化 电致发光光谱;(b)图(a)中400~600 nm范围内的放 大图;(c)室温下器件的外量子效率-电流密度曲线。
- Fig.4 (a) Normalized EL spectra of the device at room temperature and a current density of 10 mA/cm². (b) The magnification of the 400-600 nm range in figure (a).
 (c) EQE as a function of current density at room temperature.

器件A在室温下工作的温度为303.28 K,而器件 E的温度可达314.65 K。这是由于不同大小像素 点的散热效果不同导致的^[18],而当像素大小达到 500 µm以后,器件散热效果趋于一致。图4(c)为 不同器件的外量子效率(EQE)曲线,随着像素点 尺寸增大,器件的外量子效率呈下降趋势。这是 由于器件所产生的热效应导致的,温度升高使载 流子迁移速率加快,而PtOEP三线态激子寿命较 长,载流子迁移速率加快导致三线态激子浓度增 加,从而加剧了三线态激子湮灭和三线态-极化子 猝灭^[19-20],而在该过程中多余的能量将转变为热能 从而进一步升高器件温度。

3.4 不同电流密度下图案化 OLED 热效应分析

图 5 为不同电流密度下,不同像素大小器件 EL光谱中 543 nm 处峰值变化的趋势。由图 5 可 知,所有器件在 543 nm 处的峰值均随电流密度呈 线性上升趋势,表明电流密度增大导致器件热效 应增强;其中拥有大尺寸像素的器件上升趋势更 为明显。在 50 mA/cm²大电流密度注入下,器件 A 工作时温度达到 317.25 K,而器件 E 工作时温度 则高达 339.64 K。进一步表明对于器件工作过 程所产生的热效应不容忽视,尤其是在高电流密 度下愈发严重^[21-23],采用小尺寸像素的器件拥有更 好的散热效果。



图 5 543 nm 处归一化峰值随电流密度变化的拟合曲线

Fig.5 Fitting curves of normalized 543 nm EL peak intensity plotted against current density

3.5 高温下不同图案化 OLED 热效应分析

智能手机在实际应用过程中,CPU附近温度 可达到 323.15 K 左右^[4],OLED 屏幕将同时受到 CPU温度和自身所产生热效应的影响。为研究该 情况下不同像素的散热效果,我们将不同器件加 热至 323.15 K 并保温 3 min后,对器件进行测试。 测试结果如图 6 所示,当电流密度为 10 mA/cm²、 器件在 323.15 K 下工作时,543 nm 处的峰值更 加显著。根据曲线拟合可知 A ~ E 不同像素的器 件温度分别为 327.42,335.76,333.98,336.89, 337.18 K,由此可知不同像素器件的温度均高于 323.15 K,其中器件 E 的温度可高达 337.18 K。 相同像素的器件 B 和器件 C 中的热效应仍趋于一 致,与上述结果相同,进一步表明不同像素大小的 散热能力有所不同。图 6(c)为 323.15 K 下不同 器件的外量子效率,呈现趋势与上述相同。相较 于室温下工作,在323.15 K下工作时,器件的效率进一步下降。进一步印证器件温度过高会加剧 PtOEP器件激子猝灭,对器件性能产生不利 影响^[2425]。



图6 (a)323.15 K下器件在10 mA/cm²电流密度下的归一 化电致发光光谱;(b)图(a)中400~600 nm范围内的 放大图;(b)323.15 K下器件的外量子效率-电流密 度曲线。

Fig.6 (a) Normalized EL spectra of the device at a current density of 10 mA/cm² and 323.15 K. (b) The magnification of the 400-600 nm range in figure (a). (c) EQE as a function of current density at 323.15 K.

4 结 论

本文通过光刻技术在 ITO 基板上形成不同图 案化 PSPI 薄膜,并以该基板制备图案化 OLED 器 件。利用PtOEP材料的热激子发射作为分子温度 探针,以探究不同图案化 OLED 器件所产生的热 效应,进一步分析热效应对器件的影响。结果表 明,PtOEP器件所产生的热效应随像素尺寸和电 流密度增大而增加,而像素尺寸相同、总发光面积 不同的器件所产生的热效应趋于一致,表明像素 尺寸的缩小有利于器件散热。通过拟合曲线函 数,可根据EL曲线中543 nm的峰值推算出器件 所产生的热效应。PtOEP器件在室温下10 mA/ cm²电流密度工作时,像素尺寸为2000 μm的器 件温度可达314.65 K,而像素尺寸为5 µm的器件 温度仅为303.29 K。这是由于小尺寸像素可保 持与周围介质更有效的热传递,因此散热效果较 好;而大尺寸像素对流较差且缺乏横向热传输,因 此大尺寸像素热效应更为显著。当OLED 器件在 323.15 K环境温度下工作时,温度变化趋势与上 述相同,其中像素尺寸为2000 µm的器件温度最 高,可达377.18K。

器件的外量子效率曲线表明,随着热效应的 增加,器件的外量子效率呈下降趋势。这是由于 器件温度升高会增加载流子迁移速率,使PtOEP 三线态激子浓度过高,进而发生高浓度激子猝灭; 同时PtOEP器件中激子以及极化子间的碰撞概率 也随温度提高,从而加剧激子猝灭。不同像素尺 寸器件的散热性能存在差异,大尺寸像素的器件 散热性能较差,极易升高器件的工作温度,从而对 器件性能产生不利影响。因此,OLED在实际应 用中需注重器件的散热性能,尤其是控制大尺寸 器件中的结温,从而提升器件的可靠性,避免结温 过高对器件产生不利影响。

本文专家审稿意见及作者回复内容的下载地址: http://cjl. lightpublishing. cn/thesisDetails#10.37188/ CJL. 20220417.

参考文献:

- [1] GHOSH A, KHAYRULLIN I, WANG Q, et al. 3.1: Invited paper: OLED micro-displays for VR/AR applications [J]. SID Symp. Dig. Tech. Papers, 2019, 50(S1): 26-27.
- [2] WEI B, FURUKAWA K, AMAGAI J, et al. A dynamic model for injection and transport of charge carriers in pulsed

organic light-emitting diodes [J]. Semicond. Sci. Technol., 2004, 19(5): L56-L59.

- [3] YANG L Q, CHEN W, WEI B, et al. Temperature and emitting area dependence of red organic light-emitting diode performance [J]. Phys. Status Solidi A, 2014, 211(7): 1488-1492.
- [4] 倪传勇.低成本智能手机自主散热仿真与改进方案的研究 [D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2021.
 NI C Y. Simulation Analysis and Improvement of Low-cost Cellphone Autonomous Heat Dissipation [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2021. (in Chinese)
- [5] STURM J C, WILSON W, IODICE H. Thermal effects and scaling in organic light-emitting flat-panel displays [J]. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 1998, 4(1): 75-82.
- [6] PAN S H, YU H, XU H F, et al. Simulated and experimental analyses of the thermal dissipation of organic light-emitting diodes [J]. Optik, 2023, 272: 170332-1-8.
- [7] KIRCH A, FISCHER A, LIERO M, et al. Experimental proof of Joule heating-induced switched-back regions in OLEDs
 [J]. Light Sci. Appl., 2020, 9(1): 5-1-10.
- [8] VU M C, MANI D, JEONG T H, et al. Nacre-inspired nanocomposite papers of graphene fluoride integrated 3D aramid nanofibers towards heat-dissipating applications [J]. Chem. Eng. J., 2022, 429: 132182-1-10.
- [9]魏娜,熊凌昊,张民艳,等.超微OLED的制备及其光电特性的研究[J].光电子·激光,2012,23(10):1876-1879.

WEIN, XIONG L H, ZHANG M Y, et al. Fabrication of tiny-size OLED and its optical and electrical properties [J]. J. Optoelectron. Laser, 2012, 23(10): 1876-1879. (in Chinese)

- [10] POHL L, KOHÁRI Z, POPPE A. Vertical natural convection models and their effect on failure analysis in electro-thermal simulation of large-surface OLEDs [J]. *Microelectron. Reliab.*, 2018, 85: 198-206.
- [11] 吴福宝,石修灯.基于OLED光源的煤矿照明灯具的散热性分析 [J]. 能源技术与管理, 2016, 41(S1): 191-192.
 WUFB, SHIXD. Heat dissipation analysis of coal mine lighting based on OLED light source [J]. Energy Technol. Manage., 2016, 41(S1): 191-192. (in Chinese)
- [12] UCHIYAMA S, DE SILVA A P, IWAI K. Luminescent molecular thermometers [J]. J. Chem. Educ., 2006, 83 (5): 720.
- [13] BANSAL A K, HOLZER W, PENZKOFER A, et al. Absorption and emission spectroscopic characterization of platinumoctaethyl-porphyrin (PtOEP) [J]. Chem. Phys., 2006, 330(1-2): 118-129.
- [14] KALINOWSKI J, STAMPOR W, SZMYTKOWSKI J, et al. Photophysics of an electrophosphorescent platinum (II) porphyrin in solid films [J]. J. Chem. Phys., 2005, 122(15): 154710-1-16.
- [15] LUPTON J M, KLEIN J. Hot band emission and energy transfer in organic electrophosphorescent devices [J]. Chem. Phys. Lett., 2002, 363(3-4): 204-210.
- [16] LUPTON J M. A molecular thermometer based on long-lived emission from platinum octaethyl porphyrin [J]. Appl. Phys. Lett., 2002, 81(13): 2478-2480.
- [17] MANNA B, NANDI A. The triplet exciton dynamics and diffusion properties of zinc and platinum-octaethylporphyrin nanoaggregates [J]. J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 2021, 408: 113105-1-9.
- [18] MATSUSHIMA T, ADACHI C. Observation of extremely high current densities on order of MA/cm² in copper phthalocyanine thin-film devices with submicron active areas [J]. Jpn. J. Appl. Phys., 2007, 46(12L): L1179-L1181.
- [19] VAN EERSEL H, BOBBERT P A, JANSSEN R A J, et al. Monte Carlo study of efficiency roll-off of phosphorescent organic light-emitting diodes: evidence for dominant role of triplet-polaron quenching [J]. Appl. Phys. Lett., 2014, 105 (14): 143303-1-5.
- [20] WEI B, ICHIKAWA M, FURUKAWA K, et al. High peak luminance of molecularly dye-doped organic light-emitting diodes under intense voltage pulses [J]. J. Appl. Phys., 2005, 98(4): 044506-1-5.
- [21] JOO W J, KYOUNG J, ESFANDYARPOUR M, et al. Metasurface-driven OLED displays beyond 10 000 pixels per inch
 [J]. Science, 2020, 370(6515): 459-463.
- [22] KWON S K, BAEK J H, CHOI H C, et al. OLED pixel shrinkage dependence with cathode influenced by thermal effect
 [J]. IEEE Electron Device Lett., 2018, 39(10): 1536-1539.
- [23] NAKANOTANI H, SASABE H, ADACHI C. Singlet-singlet and singlet-heat annihilations in fluorescence-based organic light-emitting diodes under steady-state high current density [J]. Appl. Phys. Lett., 2005, 86(21): 213506-1-3.

- [24] NAKANOTANI H, OYAMADA T, KAWAMURA Y, et al. Injection and transport of high current density over 1 000 A/ cm² in organic light emitting diodes under pulse excitation [J]. Jpn. J. Appl. Phys., 2005, 44(6R): 3659-3662.
- [25] AZRAIN M M, MANSOR M R, OMAR G, et al. Effect of high thermal stress on the organic light emitting diodes (OLEDs) performances [J]. Synth. Met., 2019, 247: 191-201.



丁川(1997-),男,山西运城人,硕士研 究生,2020年于长沙理工大学获得学 士学位,主要从事图案化 OLED 的 研究。

E-mail: 1422912492@qq. com



王华(1977-),男,山西平定县人,博 士,教授,博士生导师,2007年于太原 理工大学获得博士学位,主要从事有 机半导体光电材料与器件的研究。 E-mail: wanghua001@tyut.edu.cn